(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 30. September 2004 (30.09.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  $WO\ 2004/083110\ A3$ 

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: G01L 9/00
- \_\_\_\_
- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/EP2004/002817
- (22) Internationales Anmeldedatum:
  - 18. März 2004 (18.03.2004)
- (25) Einreichungssprache:

- Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

103 11 757.1

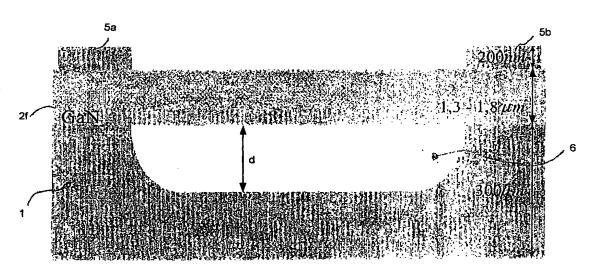
- 18. März 2003 (18.03.2003) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MICROGAN GMBH [DE/DE]; Albert-Einstein-Allee 45, 89081 Ulm (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KUNZE, Mike [DE/DE]; Heimstrasse 16, 89250 Senden (DE). DAU-MILLER, Ingo [DE/DE]; Obere Weiherstrasse 1, 89165 Dietenheim (DE). BENKART, Peter [DE/DE]; Kirchbergstrasse 12, 86447 Stotzard (DE). KOHN, Erhard [DE/DE]; Radgebweg 21, 89081 Ulm/Lehr (DE).
- (74) Anwalt: PFENNING, MEINIG & PARTNER GBR; Mozartstrasse 17, 80336 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SENSOR ELEMENT WITH SELF-SUPPORTING BAR STRUCTURES MADE OF GROUP III NITRIDE BASED SEMICONDUCTORS

(54) Bezeichnung: SENSORELEMENTE MIT FREITRAGENDEN BALKENSTRUKTUREN AUS HALBLEITERN AUF GRUPPE-III-NITRIDBASIS



(57) Abstract: The invention relates to a sensor element which comprises a group III nitride-based semiconductor structure. The semiconductor sensor element is used to determine pressure, temperature, a force, a deflection or an acceleration. It comprises a substrate base (1), a group III nitride based homogeneous semiconductor layer arranged thereon, whereby the surface of homogeneous semiconductor layer (2, 2f) facing the substrate base (1) is arranged at least partially at a distance to the surface of the substrate base facing the homogeneous semiconductor layer (2, 2f). The invention is characterized in that at least two electric terminal contacts (5) used to divert an electric output signal which can be produced by the homogeneous semiconductor layer (2, 2f), said contacts being arranged on and/or below the homogeneous semiconductor layer (2, 2f) or integrated therein.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen Sensorelement, das eine Halbleiterstruktur auf Gruppe III-Nitridbasis aufweist. Das Halbleitersensorelement dient der Bestimmung des Drucks, der Temperatur, einer Kraft, einer Auslenkung oder einer Beschleunigung. Es

#### 

FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 24. März 2005

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

weist eine Substratbasis 1, darauf angeordnet eine homogene Halbleiterschicht auf Gruppe-III Nitridbasis auf, wobei die der Substratbasis 1 zugewandte Oberfläche der homogenen Halbleiterschicht 2, 2f zumindest teilweise einen Abstand zu der der homogenen Halbleiterschicht 2, 2f zugewandten Oberfläche der Substratbasis aufweist und zeichnet sich dadurch aus, dass mindestens zwei elektrische Ableitungskontakte 5 zur Ableitung eines durch die homogene Halbleiterschicht 2, 2f erzeugbaren elektrischen Ausgangssignals auf, an und/oder unter der homogenen Halbleiterschicht 2, 2f angeordnet sind oder in diese integriert sind.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No			
T/EP2004/002817			

	•	7	₹/EP2004/002817	
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G01L9/00			
Åh	·			
	o International Patent Classification (IPC) or to both national classification	assification and IPC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ocumentation searched (classification system followed by class	sification symbols)		
IPC 7	G01L	-,,	·	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent	that such documents are include	d in the fields searched	
Electronic d	ata base con sulted during the international search (name of da	ata base and, where practical se	earch terms used)	
EPO-In	ternal, WPI Data, PAJ, INSPEC		,	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	<u> </u>		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of t	the relevant passages	Relevant to claim No.	
Α	US 2002/066319 A1 (STRITTMATTER ROBERT P ET AL) 6 June 2002 (2002-06-06) paragraph '0019! - paragraph '0031!; figures 1-3		1,50,53	
Α	YOUTSEY C ET AL: "Dopant-sele photoenhanced wet etching of G JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIAL vol. 27, no. 4, 30 April 1998 (1998-04-30), pa XP002312123 ISSN: 0361-5235 the whole document	1,50,53		
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	_/  X Patent family mei	mbers are listed in annex.	
0.00 c c c c c c c c c c c c c c c c c c	Associated the state of the sta	<u> </u>		
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filling date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed</li> </ul>		or priority date and n cited to understand t invention  "X" document of particula cannot be considere involve an inventive:  "Y" document of particula cannot be considere document is combine ments, such combine in the art.	<ul> <li>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</li> <li>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled</li> </ul>	
Date of the	actual completion of the International search	Date of mailing of the	international search report	
1	9 January 2005	26/01/20	05	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL 2280 HV Rijswijk	Authorized officer		
	NL - 2-20 TV TIJSWIJK Tel. (+31 -70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+3 1-70) 340-3016	Segerber	g, T	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT



International Application No F/EP2004/002817

•		N=1/EF2004/00281/		
C.(Continua	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<del></del>	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.	
T T	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages  CASE WESTERN RESERVE UNIVERISTY: "Silicon-Carbide-Based 400 C MEMS Sensing and Data Telemetry" ELECTRICAL ENIGINEERING COMPUTER SCIENCE, 'Online! 16 July 2004 (2004-07-16), XP002312125 Retrieved from the Internet: URL:http://vorlon.eecs.cwru.edu/{rxw54/research.htm> 'retrieved on 2004-12-29! abstract	,	1,50,53	

INTERNALIONAL SEARCH REPORT



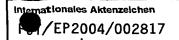
Information on patent family members

International Application No F/EP2004/002817

Patent family member(s) Publicatio n date Patent document **Publication** cited in search report date US 2002066319 06-06-2002 NONE A1

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





# A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G01L9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfst off (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  $IPK \ 7 \quad G01L$ 

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teille	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2002/066319 A1 (STRITTMATTER ROBERT P ET AL) 6. Juni 2002 (2002-06-06) Absatz '0019! - Absatz '0031!; Abbildungen 1-3	1,50,53
A	YOUTSEY C ET AL: "Dopant-selective photoenhanced wet etching of GaN" JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS TMS USA, Bd. 27, Nr. 4, 30. April 1998 (1998-04-30), Seiten 282-287, XP002312123 ISSN: O361-5235 das ganze Dokument  -/	1,50,53

X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie		
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchen bericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	erfinderischer Tätigkeit beruh end betrachtet werden		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internatio nalen Recherchenberichts		
19. Januar 2005	26/01/2005		
Name und Postanschrift der Imternationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bedienstele r		
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax. (+31–70) 340–3016	Segerberg, T		

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



Internationales Aktenzeichen / EP2004/002817

		1 0 1 / 2 1 2 2	004/00281/
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
T	CASE WESTERN RESERVE UNIVERISTY: "Silicon-Carbide-Based 400 C MEMS Sensing and Data Telemetry" ELECTRICAL ENIGINEERING COMPUTER SCIENCE, 'Online! 16. Juli 2004 (2004-07-16), XP002312125 Gefunden im Internet: URL:http://vorlon.eecs.cwru.edu/{rxw54/research.htm> 'gefunden am 2004-12-29! Zusammenfassung	enden Teile	1,50,53

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ang	Angaben zu Veröffentiligen, die zur selben Patentfamilie gehören				Po-1/EP2004/002817		
lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		t	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) Patentfami	der lie	Datum der Veröffentlichung	
US 	2002066319	A1	06-06-2002	KEINE			
					·		
				•		·	